



ArF 液浸スキャナー

NSR-S625E

Proven Solutions Through Evolution



ミドルクリティカルレイヤー向け 先端半導体製造に最適なArF液浸スキャナー

ArF液浸スキャナーNSR-S625E

NSR-S625Eは、実績のあるStreamlign Platformを継承したArF液浸スキャナーです。

前機種のNSR-S622Dからスループットを約1.3倍向上させ、稼働安定性を大幅に改善。さらに、高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」を搭載することで、さまざまな半導体の効率的な生産に貢献します。

Performance

解像度	≦ 38 nm
NA	1.35
露光光源	ArF excimer laser (193 nm wavelength)
縮小倍率	1:4
最大露光範囲	26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度	≦ 2.5 nm (MMO*1)
スループット	≧ 280 wafers/hour (96 shots)

*1 Mix and Match Overlay: 同一機種間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S625E#1 to S625E#2)

主な特長

●Streamlign Platform

Stream Alignment

- 「ストレートラインオートフォーカス」により、ウェハ表面上を一気にマッピングし、フォーカス制御精度を向上
- 5眼FIAにより生産性を確保しつつアライメント計測数を増やすことが可能

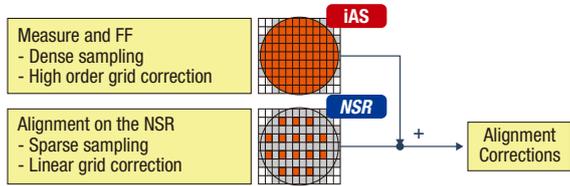
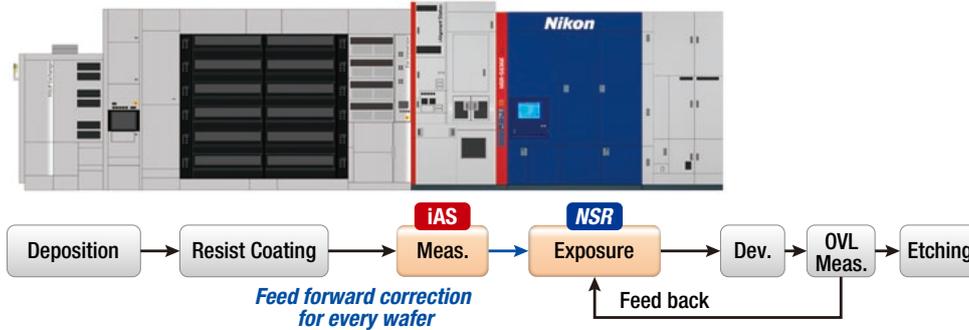
Bird's Eye Control

- 高精度エンコーダーおよび干渉計のハイブリッドシステムにより、最適なステージパフォーマンスを実現

Modular² Structure

- モジュール設計による納入、メンテナンスの簡易化

●高機能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」



アライメントステーションとは、露光装置のスループットを落とすことなく高速・高精度にウェハを計測し、グリッドエラーの補正を可能にするシステムです。これをインラインで露光装置内に組み込んだものがiASになります。iASにより、スループットを低下させることなく、全ショットでの多点アライメントが可能になり、飛躍的な精度向上を実現しました。

クラス1レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

●このカタログは2024年7月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。

●このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2024 NIKON CORPORATION

<https://semi.nikon.com/>

株式会社 **ニコン**

精機事業本部 商品戦略部 140-8601 東京都品川区西大井1-5-20 電話(03)6743-5533

株式会社 **ニコンテック** 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911